

Ptfeウェーハ洗浄バスケット 4インチ エッチングラック 耐酸アルカリ カスタムマスクキャリア

商品番号: PL-CP90



前書き

半導体ウェーハ洗浄および化学処理用に設計された精密設計のPTFEエッチングバスケット。これらの耐酸性、高純度洗浄ラックは、過酷な実験室環境での汚染ゼロを保証します。高度な製造および研究用途向けに、特定の産業用マスクおよびウェーハ寸法に合わせて完全にカスタマイズ可能です。

[詳細を学ぶ](#)

用途	説明	主な利点
半導体ウェットエッチング	シリコンウェーハを酸性溶液に浸漬し、薄膜を除去または表面を洗浄します。	HFおよびその他の侵食性エッチャントに対する完全な耐性により、材料劣化がゼロになります。
フォトマスク洗浄	敏感な石英マスクを特殊な化学洗浄およびすすぎサイクルを通して搬送します。	低衝撃の材料接触により、複雑なマスクパターンの表面損傷を防止します。
太陽電池製造	テクスチャリングおよびドーピング洗浄工程中の太陽光発電ウェーハを処理します。	高スルーput容量と化学的安定性により、全体的な製造効率が向上します。
MEMS処理	多様な化学エッチング環境を通してマイクロ電気機械システムを取り扱います。	精密なスロット加工により、小型で壊れやすい部品が攪拌中に確実に保持されます。
微量金属分析	分析試験前に、高純度酸浴で実験器具および容器を洗浄します。	金属を含まない洗浄環境を提供することで、交差汚染を排除します。
ナノテクノロジー研究	新規化学溶液および反応性環境における実験用基板を管理します。	温度および化学的適合性における汎用性により、多様な研究プロトコルをサポートします。

特徴	PL-CP90の仕様詳細
モデル番号	PL-CP90
材料構造	高純度PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
ウェーハサイズ互換性	4インチ (標準) /完全にカスタマイズ可能な寸法
スロット構成	カスタマイズ可能なスロット数およびピッチ間隔
耐薬品性	酸、アルカリ、溶剤に対する普遍的な耐性
動作温度範囲	-200°C ~ +260°C
表面仕上げ	精密CNC加工 / 超低表面粗さ
ハンドル設計	取り外し可能または固定式スタイル (カスタマイズ可能)
排水設計	高流量オープンフレームワーク形状

用途	説明	主な利点
特徴	PL-CP90の仕様詳細	
製造方法	エンドツーエンドのカスタムCNC製造	
注文タイプ	クライアント仕様に基づくカスタマイズ製品	